

CVD-handy®



ÜRÜN BİLGİSİ

Vaksis "handy" serisi, handy kelimesinin sözlük anlamı gibi kolay ve rahat kullanılabilir. Bu seri, Nitrürlerin (Si_3N_4), Oksitlerin (TiO_2 , SiO_2), Yarıiletkenlerin ($\alpha\text{-Si:H}$ (i), $\alpha\text{-Si:H}$ (n), $\alpha\text{-Si:H}$ (p)) ve karbon benzeri yapıların (DLC) büyütülmesi için kullanılabilir. Bu platformdaki sistemlerde çeşitli konfigürasyonlar ile Kimyasal Buhar Biriktirme (CVD) Yöntemi uygulanmaktadır. Vaksis' "CVD-handy" konfigürasyon sınıfları aşağıda belirtildiği gibidir:

KONFIGÜRASYON MATRİSİ

Teknikler	Mikrodalga Plazma Destekli CVD (MPCVD)	Plazma Destekli CVD (PECVD)	Atomik Katmanlı CVD (ALD)	Sıcak Filament CVD (HFCVD)
CVD-handy	✓	✓	✓	✓

Bu seri, Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi ile SiO_2 , SiN_x , ($\alpha\text{-Si:H}$), SiC, DLC veya benzer ince filmlerin büyütülmesinde kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Basınç Ölçümü $\approx 10^{-7}$ Torr
Altaş Boyutu Maks. 6" çapında
Altaş Isıtma Maks. 400 °C
Altaş Döndürme 3-30 rpm
Soğutma Gerektiğinde
Yükleme Kaldırılarak açılan üst kapaktan veya yüklem odasından
Kontrol Tam Otomatik
Farklı Gaz Türleri için Kütle Akış Kontrolcüsü Sayısı Maks. 12
Ek Gaz Emniyeti İstenildiğinde sunulabilmektedir
Gaz Kabini Dahildir ve Sistem Yazılımına Entegredir

GÜÇ KAYNAKLARI

-Mikrodalga Plazma-Destekli CVD (MPCVD) içinde Mikrodalga güç kaynağı
-Kapasitif Eşleşmiş Plazma Kaynağı (CCP) için DC ve/veya RF Güç Sağlayıcısı ve İndüktif Eşleşmiş Plazma (ICP) Kaynağı için RF Güç Sağlayıcısı

YAZILIM

Sistem operasyonu kolay kullanılabilir bir yazılıma sahiptir. Bu, sadece otomasyon ve kontrol yazılımı değil, ayrıca kullanıcının özel kaplama deneyimlerini tasarlayabildiği, daha önceden kullanılan proses parametrelerini inceleyebildiği ve geliştirilmiş reçeteleri/kaplamaları kullanabildiği bir yazılımdır. Yazılım tarafından yürütülen operasyonlarda insan ve makine güvenliği önem açısından ilk sıradadır. Grafik kullanıcı arayüzü kullanıcıya kullanım sırasında sistem durumunu görme imkanı sunmaktadır.